

# 第23回 J I C C 洗浄技術フォーラム2019

～IoT, EV, 5G そしてスマートソサエティ時代の洗浄技術を考える～

開催日時 : 2019年 9月 5日 (木) 10:00～17:00  
会場 : パシフィコ横浜 アネックスホール F203・204 会議室 定員:180名  
対象 : 今そして将来の洗浄を考える洗浄ユーザー、研究者、設計者、技術者  
洗浄剤・洗浄機及びその周辺機メーカーの管理者、開発者、技術者  
有力な商材・技術を求める商社・販売店の皆様  
主催 : 日本産業洗浄協議会 (J I C C) TEL:03-5777-0791 (代)

## 講演・発表プログラム

<b>フォーラム会場 (2F:アネックスホール F203・204 会議室)</b>	
司会: 守田章治 (クロロカーボン衛生協会)、前野純一 (荒川化学工業(株))	
<b>開会挨拶</b> 10:00～10:10	開会挨拶: 日本産業洗浄協議会会長 株式会社トクヤマMETEL 代表取締役社長 甲斐 博泰 ガイダンス: 日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 天田 徹
<b>技術発表</b> 10:10～10:50	難しいフラックス洗浄に挑む MPC 洗浄の有用性 ゼストロンジャパン株式会社 チーフアプリケーションエンジニア 加納 裕也氏 近年、電子デバイス洗浄は、狭ピッチ間洗浄、難溶性残渣洗浄など多くの課題が生じている。本講演では、それらの事象メカニズムの解説と、弊社の洗浄技術の有用性を紹介する。
<b>特別講演: 特別講演会場(1F メインステージ)</b>	
11:00～12:00	激動の時代を迎えた電子デバイス産業の未来構図 ～半導体、電子部品、自動車部品の設備投資を最新レポート～ 一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 副会長 泉谷 渉氏 第4の産業革命ともいふべき IoT の技術革新が全世界で巻き起こっている。IoT がもたらす新市場、自動車分野、電子デバイスのこれからの鋭い視線で読み解く。
12:00～13:00	昼食休憩
<b>フォーラム会場 (2F:アネックスホール F203・204 会議室)</b>	
司会: 梅木義彦 (JICC)、勢田順子(日本ソルベイ(株))	
<b>招待講演</b> 13:00～13:50	時計メーカーから総合精密加工メーカーへ シチズンファインデバイス株式会社 代表取締役社長 近藤 隆造氏 時計技術で培った技術をベースに多角化事業の軌跡(1980年代より)について紹介する。
13:50～14:00	休憩
<b>技術発表</b> 14:00～14:40	洗浄専門業における洗浄装置・洗浄事例と品質管理 有限会社 本間産業 専務取締役 本間 尚貴氏 市場ニーズに対応するための洗浄専門業としての取組みと洗浄装置・洗浄事例と品質管理を紹介する。
14:40～15:20	水系洗浄機の液汚染度と付着油分の測定 森合精機株式会社 開発課 課長 松村 繁廣氏 電動化に移行する自動車の主要な機能部品には高い洗浄品質が要求される。これを実現するためには洗浄液汚染度と被洗浄品の付着油分の測定管理が重要である。この要求に対応した油分測定機を開発したので紹介する。
15:20～15:30	休憩
15:30～16:10	フッ素系洗浄機3機種「縦型ワパス式 FISTA」「ブッシャー搬送式2槽式 FISTA」「フッ素系多槽式省溶剤洗浄機」の紹介 株式会社クリンビー 代表取締役社長 岡村 和彦氏 今年末で HCFC-225 が全廃となり、その代替として HFO が登場したが高価な為、洗浄機には省溶剤が求められる。本稿では省溶剤洗浄機を3機種紹介する。
16:10～16:50	次世代フッ素系溶剤 AMOLEA® AS-300 のご紹介 AGC株式会社 化学品カンパニー 機能化学品事業本部 フロロケミカルズ事業部 溶剤グループ マネージャー 花田 毅氏 新たに開発し上市した次世代フッ素系溶剤 AMOLEA® AS-300 の最新動向について詳しく紹介する。

フォーラム聴講費 (カラーテキスト代を含む)

会員 : 13,000 円/人 + 税、 非会員 : 17,000 円/人 + 税

◎フォーラム会場の出入りは、予めお送り致します「聴講券」で自由に行えます。